

Abkürzungsverzeichnis

ASIC	Application Specific Integrated Circuit
BPSG	Bor-Phosphor dotiertes Silikatglas
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
COB	Chip on board
DMM	Digitalmultimeter
ESD	Electro static discharge
FEM	Finite Elemente Methode
FFT	Fast Fourier Transform
FGS1	Fluxgatesonde 1
GOX	Gateoxid
GPIB	General purpose interface bus
IMS	Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme
IFW	Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung
KOH	Kalilauge (Kaliumhydroxid-Lösung)
MET1,MET2	Metallisierungsebenen des „double metal“ CMOS-Prozesses
MOKE	Magnetooptischer Kerr-Effekt
MOS	Metal Oxid Semiconductor
NiFe	Nickeleisen-Legierung mit ca. 80 % Ni (Permalloy)
PC	Personalcomputer
PATMOS	Parameter Test of MOS-Devices
PE-CVD	Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition
PSD	Phasensensitiver Demodulator
REM	Rasterelektronenmikroskop
SMU	Source measurement unit
SNR	Signal to noise ratio (Signal-Rausch-Verhältnis)
S&H	Sample and Hold
USG	Undotiertes Silikatglas (Siliziumdioxid)